

## 46<sup>th</sup> Silicon Symposium への参加

広島大学大学院工学研究科応用化学専攻 村上 和也



2015年6月21日から24日にかけて46th Silicon Symposiumがアメリカのカリフォルニア大学デービス校で開催されました。今回、私はケイ素化学協会から渡航費のご支援をいただき、ポスター発表を行う貴重な機会を得ましたので報告させていただきます。

会場となったデービス市はカリフォルニア州の内陸側に位置し、広大な農地が広がるとてもどかな土地でした。雲一つない青空が印象的で、気温は日中30度以上まで上がり、この時期梅雨である日本とは対照的でした。

講演は、2会場に分かれて行われ、いずれの会場でも活発に議論が飛び交っていました。会場が少なかったので興味のある講演はほとんど聞くことができ、最新のケイ素化学に関する知見を深めることができました。日本からの参加者は少なかったのですが、会場で群馬大学や東北大学の学生と知り合いになり、研究に関する意見交換をすることができました。



ポスターセッションは2日にかけて行われ、2日目には「Si Slam」でのショートトークを行いました。「Si Slam」は昨年ベルリンで開催されたISOS XVIIで初めて行われた企画で、自分の研究の魅力を分かりやすく、面白く伝えるというものです。どの学生も趣向を凝らした発表で、かつ研究の内容も魅力的なものが多く、大いに刺激を受けました。私自身の発表は、海外での口頭発表ということもあり緊張しましたが、その後のポスターで多くの方に足を運んでいただくことができました。R. West教授やR. Laine教授などの先生方からの貴重なアドバイスや海外の学生との意見交換は非常に貴重な経験であり、今後の研究の糧だと思います。また、会期中に地元で生産されたワインやビールをいただくことができ、これも良い経験となりました。

最後になりますが、このような貴重な機会を与えてくださったケイ素化学協会の皆様、ならびに学会中にお世話になった諸先生方に心から感謝申し上げます。

